



ระบบการทำแห้ง Excimer

รังสีอัลตราไวโอเลตสูงความยาวคลื่นสำหรับการทำให้ผิวเรียบและการใช้งานอื่น ๆ



ออกแบบและผลิตในประเทศไทย

gewuv.in.th





หลอด ExciRay ของ GEW

ระบบหลอด ExciRay ของ GEW ใช้หลอดโคอีเล็กทริกแบบรีเออร์ดิสชาร์จ (DBD) เพื่อผลิตรังสีอัลตราไวโอเลตสัญญาณที่โมโนโครมาติก โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 172 นาโนเมตร รังสีดังกล่าวถูกนำมาใช้โดยทั่วไปในกระบวนการเคลือบผิว ทำให้พื้นผิวเรียบและเรียบเนียน การปรับเปลี่ยนแรงเสียดทานผิวเพื่อให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้น หรือเพื่อการทำความสะอาดผิวเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เซมิคอนดักเตอร์) และอุตสาหกรรมทางการแพทย์

หลอด ExciRay ของ GEW สามารถผลิตได้ความยาวสูงสุด 255 ซม. และสามารถผสมผสานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณในรูปแบบที่กำหนดเองได้ รวมถึงให้ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการควบคุมก๊าซในโตรเจน

นอกจากนี้หลอด ExciRay ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ UV ของ GEW ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อใช้ในกระบวนการเจลาหรือการทำแห้งขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ GEW สามารถหาโซลูชันลดความเงางามของสารเคลือบสำหรับกระบวนการผลิตของคุณ ด้วยทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

การทำให้ผิวด้าน

- แมตต์ล้าลึกพิเศษ @ 60 และ 85°
- สัมผัสนุ่ม
- ไม่จำเป็นต้องใช้สารเพิ่มความต้านเพื่อเพิ่มความทนทานในการเคลือบผิว และช่วยทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- เปิด / ปิดการเคลือบด้านได้ทันที
- ใช้ร่วมกับขั้นตอน pre-gelling และการทำแห้งขั้นตอนสุดท้าย

การปรับเปลี่ยนผิวสัมผัส

- การเพิ่มพลังงานของผิวสัมผัส

เครื่องสำหรับห้องปฏิบัติการแบบกำหนดเอง

พร้อมใช้งานสำหรับการวิจัยและพัฒนา



ExciRay สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำแห้งด้วยแสงยูวี สำหรับใช้ในห้องแลปเพื่อการควบคุมคุณภาพและการวิจัยพัฒนา

การใช้งานร่วมกันของหลอดเมอคิวรี หลอดแอลอีดี และหลอด Excimer มีทั้งแบบมีหรือไม่มีก๊าซในโตรเจน

เครื่องทำแห้งสำหรับห้องปฏิบัติการมีให้เลือกหลายขนาด ทั้งน้ำหนักและช่วงความเร็ว

กรุณาติดต่อ GEW สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้าสูงสุด	5 วัตต์/เซนติเมตร
ความยาวคลื่นสูงสุด	172 นาโนเมตร*
ความเข้มแสงสูงสุดที่จุดโฟกัส	65 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร
ความยาวสูงสุด	300 เซนติเมตร
ขนาดมาตรฐาน กว้าง	145 มิลลิเมตร x สูง 425 มิลลิเมตร
ระบายความร้อน	ก๊าซในโตรเจน
มาตรฐานขณะปฏิบัติงาน	40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)
มาตรฐานความชื้นสูงสุด	ไม่มีการกลั่นตัวของหยดน้ำ

* ความยาวคลื่น 222 & 308 นาโนเมตร มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

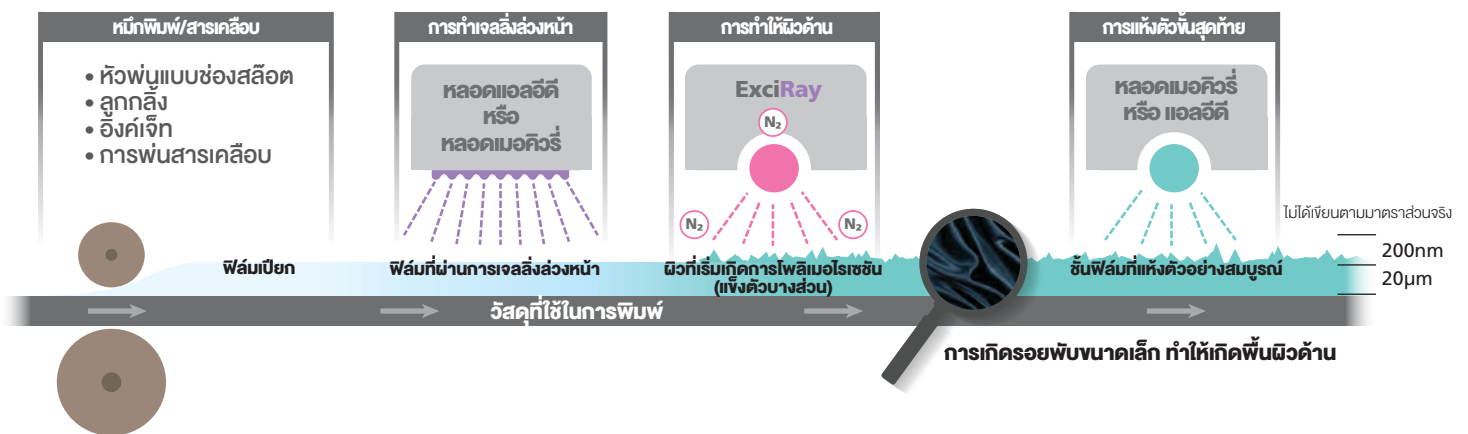




กระบวนการลดความเงาด้วย ExciRay

กระบวนการที่ใช้ในการลดความเงาของผิวเคลือบสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ รวมถึงการลามิเนตตกแต่งเหมาะสำหรับพื้นและเฟอร์นิเจอร์, พื้น PVC, แผ่นไม้, ชิ้นส่วนพลาสติก, การเคลือบมัน เป็นต้น

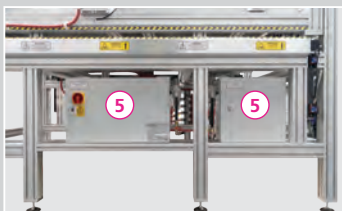
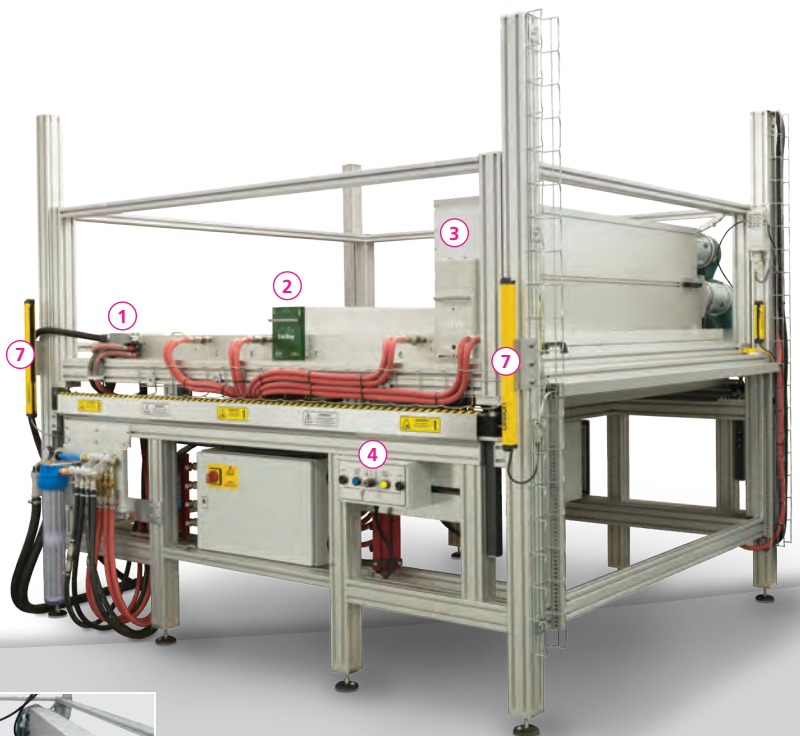
- **การเจลลิ่ง (Gelling):** เพื่อเพิ่มความหนืดของสารเคลือบบางส่วน ช่วยให้การปิดตัวระดับไมโคร (microfolding) ที่เกิดจาก ExciRay ได้ดีขึ้น สามารถปรับพลังงานในขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนผิวสัมผัส ความเงา (ที่มุม 85°) และคุณสมบัติแบบนุ่ม โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไนโตรเจนอินเนอร์ท
- **การทำให้ผิวด้าน (Mattification):** รังสี UV ที่ความยาวคลื่น 172nm จากหลอด ExciRay จะทำให้ชั้นบนสุดของสารเคลือบแห้งสนิท การหดตัวของชั้นเคลือบทำให้เกิดรอยพับระดับจุลภาค ส่งผลให้พื้นผิวมีความด้านกระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนอินเนอร์ท และไม่สามารถทำได้ทันที ต้องใช้เวลาในการพักก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอบแห้งสุดท้าย
- **การแห้งตัวขั้นสุดท้าย:** พลังงานจากหลอดเมอคิวรีหรือหลอดแอลอีดีที่มีพลังงานสูงจะช่วยให้สารเคลือบแห้งตัวได้ดียิ่งขึ้นจนถึงชั้นในสุด คุณสามารถเลือกใช้ก๊าซเฉื่อย (inerted) ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งาน



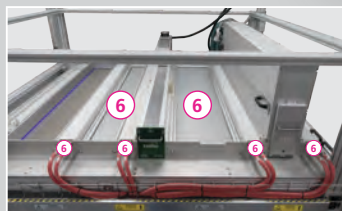
การติดตั้งทั่วไป

การติดตั้งแต่ละครั้งจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องจักรของคุณโดยเฉพาะ การทำให้ผิวด้านสามารถทำได้ทั้งแบบพื้นราบ (ตามภาพ) หรือบนลูกกลิ้งทำความเย็น ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องเคลือบ

- ① การเจลลิ่งล่วงหน้า: 395 นาโนเมตร ด้วยรุ่น LeoLED2
- ② การทำให้พื้นผิวด้าน: 172 นาโนเมตร ด้วยรุ่น ExciRay
- ③ การแห้งตัวขั้นสุดท้าย: หลอดเมอคิวรี ด้วยรุ่น NUVA2
- ④ แผงควบคุมการปรับความสูง
- ⑤ ตู้ไนโตรเจน
- ⑥ ห้องอบไนโตรเจน (Inert)
- ⑦ ม่านนิรภัย



ภาพด้านหลัง - ตู้ควบคุมไนโตรเจนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ



ภาพมุมมอง - ห้องที่ใช้กับก๊าซไนโตรเจนพร้อมหัวฉีดแบบปรับได้

ไม่ต้องกังวล... ทีมงานของเราพร้อมดูแลคุณ

บริการตรวจสอบระยะไกล GEW



ระบบตรวจสอบระยะไกลซึ่งใช้เทคโนโลยี IoT ที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในทุก ระบบ GEW RHINO/RLT UV และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Industry 4.0

ระบบทั้งหมดเหล่านี้ถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอดทั้งปี (24/7/365)

ด้วยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ GEW สามารถให้บริการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุดในอุตสาหกรรม

รายงานประสิทธิภาพของระบบ

ระบบจะบันทึกการใช้งานผ่าน Event Log อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานให้ลูกค้าเป็นระยะ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้พลังงาน, ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ และภาพรวมของระบบ

ระบบควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า RHINO

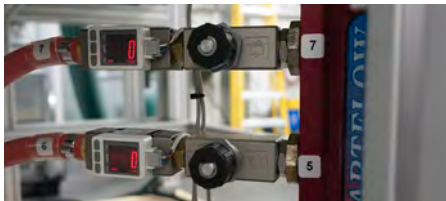


แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า RHINO/RLT (PSUs) ให้กระแสไฟที่เหมาะสมกับหลอดเมอคิวรีหรือ LED ในขั้นตอน pre-gelling และ final cure โดยหม้อแปลงของ ExciRay จะติดตั้งรวมอยู่ในตู้ RHINO และระบบทั้งหมดควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสเดียว สะดวกต่อการใช้งานแบบครบวงจร (Turnkey Solution)



รับประกัน 5 ปี

การเลือกใช้แพ็คเกจ GEW's embedded service ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ GEW และช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนไว้ **GEW ผู้จัดจำหน่ายระบบ UV เพียงรายเดียวที่เสนอการรับประกันในระดับนี้สำหรับระบบทั้งหมด**



สำนักงานใหญ่

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

ประเทศอังกฤษ +44 1737 824 500 เยอรมนี +49 7022 303 9769

สหรัฐอเมริกา +1 440 237 4439

E sales@gewuv.com W gewuv.in.th